

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成22年4月15日(2010.4.15)

【公開番号】特開2007-294416(P2007-294416A)

【公開日】平成19年11月8日(2007.11.8)

【年通号数】公開・登録公報2007-043

【出願番号】特願2007-56762(P2007-56762)

【国際特許分類】

H 0 5 B 33/04 (2006.01)

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

【F I】

H 0 5 B 33/04

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成22年3月3日(2010.3.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板と、前記基板上に形成されている有機発光素子と、前記有機発光素子上に形成されており、前記有機発光素子を覆っている防湿層と、を有し、前記有機発光素子は、前記基板側から順に下部電極と、有機化合物層と、上部電極と、を有する有機発光装置において、前記防湿層は重水素を含むことを特徴とする有機発光装置。

【請求項2】

前記防湿層は、窒化シリコン、酸化シリコン、酸窒化シリコンのいずれかからなることを特徴とする請求項1に記載の有機発光装置。

【請求項3】

基板と、前記基板上に順に配置されている下部電極と有機化合物層と上部電極とを有する有機発光素子と、前記有機発光素子を覆っている防湿層と、を有する有機発光装置の製造方法において、

前記有機発光素子を、前記基板上に形成する工程と、

前記防湿層を、重水素ガスとその他の原料ガスとを反応させることにより前記有機発光素子上及び前記有機発光素子の周辺に露出する前記基板上に、形成する工程と、を有することを特徴とする有機発光装置の製造方法。